

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 H1909-01	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/14343	国際出願日 (日.月.年) 12.11.03	優先日 (日.月.年) 12.11.02
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. H01S5/022, G02F1/377, G02B6/42		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。

☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 31.05.2004	国際予備審査報告を作成した日 01.03.2005	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)	2K 8422
	近藤 幸浩 印 電話番号 03-3581-1101 内線 3253	

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	2-15, 17-19	有
	請求の範囲	1, 16	無
進歩性(IS)	請求の範囲	3, 6-8, 17-19	有
	請求の範囲	1, 2, 4, 5, 9-16	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-19	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

次の各文献はいずれも国際調査報告で引用されたものである。

文献1:EP 1041419 A1	(NEC CORPORATION)	2000.10.04
文献2:日本国実用新案登録出願昭55-52516号(日本国実用新案登録出願 公開昭56-154173号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を 記録したマイクロフィルム(富士通株式会社)		1981.11.18
文献3:JP 2001-242499 A	(日本碍子株式会社)	2001.09.07
文献4:JP 2001-242349 A	(京セラ株式会社)	2001.09.07
文献5:US 6261858 B1	(Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.)	2001.07.17

・請求の範囲1, 16について

請求の範囲1, 16に記載された発明は文献2, 4により新規性を有しない。
光導波路デバイスが半導体レーザと光結合する部分において、サブマウントに前記半導体レーザの出射端面と平行に溝を形成し、前記光導波路デバイスの接着剤層が前記溝の前記半導体レーザから遠い側の縁に接する位置から溝内にわたる範囲とすることは、例えば文献2(特に第4図(a), (b))及び4(特に段落0029末尾文)にも示されているような慣用技術である。

・請求の範囲2, 11-14について

請求の範囲2, 11-14に記載された発明は文献2, 4により進歩性を有しない。各部の大きさ・間隔は通常用いられる程度の値と用いられる。

・請求の範囲4, 5, 9, 10, 15について

請求の範囲4, 5, 9, 10, 15に記載された発明は文献2-5により進歩性を有しない。前記文献2, 4にも示されているような慣用技術は、文献3及び5(特にFIG. 15, 16)にも示されているような第二高調波発生デバイスについても当然に用いられるものと認められる。ここで文献5には、前記第二高調波発生デバイスの入射端面近傍と出射端面近傍の双方を含むサブマウント上の数カ所に、前記半導体レーザの出射端面と平行な溝を形成し、これらの溝に沿って接着剤層を設けることが示されている。溝間の間隔は当業者が適宜設定しうる単なる設計的事項と認められる。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

- ・請求の範囲 3, 6-8, 17-19 について
請求の範囲 3, 6-8, 17-19 に記載された発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者に自明なものでもない。